

Toppan Photomask and EVG Collaborate on Nanoimprint for Photonics Manufacturing – September 26, 2022



EV Group und Toppan Photomask bündeln ihre Kräfte

Redakteur: Christian Schewe

Die EV Group und Toppan Photomask haben eine Vereinbarung zur gemeinsamen Vermarktung von Nanoimprint-Lithographie (NIL) als Verfahren für die Hochvolumenfertigung in der Photonikindustrie geschlossen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, NIL als Standard-Produktionsverfahren für die Photonik-Fertigung zu etablieren und seine Umsetzung in der Hochvolumenfertigung zu beschleunigen, um eine Vielzahl von Anwendungen Realität werden zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu diesen Anwendungen gehören Augmented/Mixed/Virtual-Reality-Headsets, Smartphone- und Automobilsensoren sowie bildgebende medizinische Systeme.

Im Rahmen dieser nicht-exklusiven Zusammenarbeit werden EVG und Toppan Photomask ihr Wissen, ihre Expertise und ihre Dienstleistungen bündeln, um NIL-Entwicklungskits unter Verwendung von Master-Templates von Toppan Photomask sowie Anlagen- und Prozessentwicklungsdienstleistungen von EVG zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich werde EVG interessierten Unternehmen NIL-Technologie und Produktdemonstrationen an EVGs NILPhotonics®-Kompetenzzentrum am Hauptsitz in Österreich anbieten.

„EVGs NIL-Anlagen und Prozesse sind international führend und ermöglichen ein kosteneffizientes Wachstum in der Photonik und anderen kommenden Anwendungen, die jetzt auf die NIL-Technologie umgestellt werden. Toppan Photomask sieht eine glänzende Zukunft, da sich NIL zu einer weiteren erfolgreichen Lithographie-Lösung entwickelt, die durch die etablierten Stärken beider Unternehmen ermöglicht wird“, sagt Chan-Uk Jeon, Chief Technology Officer von Toppan Photomask Co, Ltd.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Toppan Photomask, um die Nanoimprint-Lithographie in die Mainstream-Fertigung zu bringen. Als einer der führenden Anbieter von Halbleiter-Photomasken verfügt Toppan Photomask über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit standardisierten

Produktionsmethoden, welche die strengsten Fertigungsanforderungen der Welt erfüllen“, so Markus Wimplinger, Corporate Technology Development and IP Director bei EV Group.

<https://evertiq.de/design/29196>